

## ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИИ БЛОК-СОПОЛИМЕРОВ ПРОПИЛЕНА С ЭТИЛЕНОМ МЕТОДОМ СПЕКТРОВ МУТНОСТИ

*Попов В. П., Неткач Л. А.*

Блок-сополимеры (БС), полученные последовательной полимеризацией пропилена и этилена в присутствии катализатора  $TiCl_3-Al(C_2H_5)_2Cl$ , представляют собой дисперсию кристаллической фазы полиэтилена (ПЭ) в полипропилене (ПП) [1]. Характер взаимодействия кристаллитов ПП и ПЭ, размер и форма включений ПЭ оказывают влияние на свойства БС, поэтому изучение морфологии БС представляет несомненный интерес.

В настоящем исследовании морфологию БС изучали методом спектров мутности [2, 3]. Исследовали пленки полимера толщиной 20—30  $\mu\text{м}$ , спрессованные из расплава при температуре 230° и давлении 150  $\text{kG}/\text{cm}^2$ . Пленки закаляли в воде при комнатной температуре. Спектр мутности в интервале длин волн 2900—10 000 Å снимали на спектрометре СФ-4А (оборудованном термоковшом) при температурах от 20 до 170°. Чтобы уменьшить поверхностное рассеяние света, пленки погружали в силиконовое масло.

На рис. 1 показано изменение оптической плотности пленок ПП и БС при нагревании от 23 до 170°. Из рисунка видно, что с повышением температуры до 150° мутность ПП остается постоянной, что указывает на отсутствие структурных изменений, рассеивающих свет, однако в БС при температуре 130° мутность (оптическая плотность) увеличивается более чем на 300 %. При 130° происходит плавление ПЭ, при этом существенно изменяется его плотность, что может послужить причиной рассеяния света. Другой причиной, увеличивающей мутность пленки при 130°, может быть образование микротрещин и пустот, появившихся при тепловых деформациях ПЭ.

Идентификацию рассеивающих частиц можно провести на основании анализа уравнения, связывающего удельную мутность с параметрами рассеивающих частиц [4]

$$\frac{D/d}{\Phi} = A \frac{2(m-1)K(\alpha, m)}{2\alpha(m-1)} = \frac{2(m-1)K(\rho, m)}{\rho}, \quad (1)$$

где  $\rho = \alpha(m-1)$ ;  $m = \mu_0/\mu_{\text{пп}}$  и  $\mu_0$  — коэффициенты преломления ПП и рассеивающих частиц соответственно;  $\alpha = (2\pi r/\lambda)\mu_{\text{пп}}$  — относительный размер рассеивающих частиц,  $r$  — радиус рассеивающих частиц,  $\lambda$  — длина волны света,  $\Phi$  — объемная концентрация рассеивающих частиц,  $d$  — толщина исследуемой пленки,  $A$  — коэффициент.

Как следует из уравнения (1), оптическая плотность может вырасти в результате изменения  $m$ ,  $K(\alpha, m)$ ,  $\alpha$  и  $\Phi$ , поэтому следует оценить, как перечисленные параметры изменяются при переходе ПЭ из кристаллического состояния в жидкое.

На рефрактометре с термокамерой было определено, что  $\mu_0$  (для ПЭ) при нагреве 20—130° уменьшается от 1,53 до 1,437, а  $\mu_{\text{пп}}$  от 1,51 до 1,42. Таким образом, значение  $m = \mu_0/\mu_{\text{пп}} = 1,01$  и практически не изменяется с повышением температуры. Величина  $\alpha$ , а следовательно, и  $\rho$  уменьшается не более чем на 20 % в связи с изменением  $\mu_{\text{пп}}$ . Коэффициент  $K(\rho, m)$ , согласно [5], изменяется пропорционально  $\rho$  для  $\rho < 3,5$  (ниже будет показано, что для БС  $\rho < 3$ ). Объемная доля ПЭ  $\Phi$  при плавлении увеличивается на ~15 %. Анализируя изменение параметров  $m$ ,  $\rho$ ,  $K(\Phi, m)$  и  $\Phi$ , можно прийти к заключению, что оптическая плотность в результате перехода ПЭ в жидкое состояние может изменяться на несколько десятков процентов. В действительности оптическая плотность увеличивается

более чем на 300%, следовательно, рассеивающими частицами являются не включения ПЭ, а, вероятно, микропустоты, появляющиеся при тепловых деформациях.

Размер микропустот, появляющихся при плавлении ПЭ, можно вычислить из уравнения (2), если известно  $m$  [5]

$$n(\alpha, m) = \frac{\partial \lg \Delta D/d}{\partial \lg \lambda}, \quad (2)$$

где  $n$  — волновой экспонент в уравнении Ангстрема  $\Delta D \sim \lambda^n$ ,  $\Delta D = D_{130} - D_{20}$ .  $D_{130}$  и  $D_{20}$  — оптическая плотность соответственно при 130 и 20°. Волновой

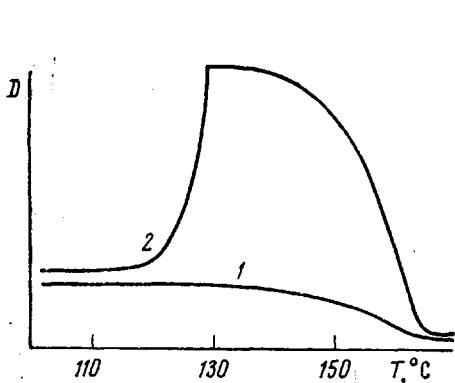


Рис. 1

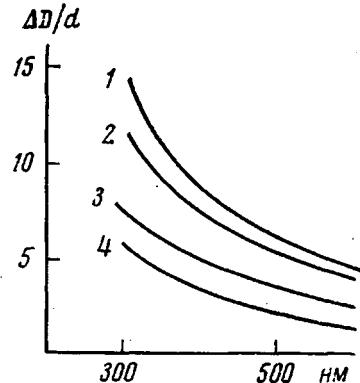


Рис. 2

Рис. 1. Изменение оптической плотности пленок ПП (1) и БС (2) в зависимости от температуры

Рис. 2. Изменение  $\Delta D/d$  при нагревании пленок полимера до 130° в зависимости от длины волны; содержание ПЭ в БС 25 (1), 20 (2), 10 (3) и 5% (4)

экспонент  $n$  можно определить из функции  $\Delta D \sim \lambda^n$ , которая представлена для серии БС на рис. 2. Расчеты показывают, что уравнение (2) хорошо описывается прямой линией в интервале  $\lambda = 2800 - 10000 \text{ \AA}$  и значения для разных образцов БС варьируют от  $n=1,3$  до  $n=2$ . Принимая для пустот  $\mu_0 \approx 1$ , определяем  $m \approx 0,7$ . По табуляциям [4] для  $n=1,3-2$  находим  $r = -2,5-0,5$ . Из уравнения  $r = 2\lg/\lambda \cdot \mu_{\text{пп}} \cdot (m-1)$  для  $\lambda = 4000 \text{ \AA}$  можно рассчитать  $r = 0,495\rho$ , т. е. средний радиус пустот для исследованных БС изменяется от 1000 Å до 250 Å, что по порядку величины соответствует размерам субмикроскопических трещин, образующихся в полимерах при деформации [6].

Таким образом, для гетерогенной системы БС пропилена с этиленом при нагревании до 130° увеличивается мутность, что может быть вызвано образованием субмикротрещин в результате циклических тепловых деформаций ПЭ.

В результате многократных циклов нагрева до 130° и охлаждения до 20° оптическая плотность пленок БС при 20° также увеличивается. Изменение свойств БС в результате серии циклов нагрев — охлаждение приведено ниже.

Количество циклов	0	1	1a	2	3	4	5	10
$D_{20}$ при $\lambda = 4000 \text{ \AA}$	0,130	0,163	0,163	0,170	0,173	0,178	—	—
Температура хрупкости, °C	-20	-24	-23	-26	—	—	-30	-30

Проводили исследование влияния мутности пленок при 20° на их температуру хрупкости. Температуру хрупкости определяли на пластинках толщиной 0,5 мм, которые изгибали при температурах ниже комнатной под углом 90°. Температура, при которой в пластинке развивалась трещи-

на, принималась за температуру хрупкости. Воспроизводимость анализа  $\pm 2^\circ$ . Пластиинки прессовали при  $230^\circ$  и закаляли в воде. Готовые пластиинки помещали в нагретую до  $135^\circ$  печь, где в течение нескольких секунд нагревали до появления помутнения, после чего быстро переносили в холодную воду. Циклы нагрев — охлаждение повторяли многократно, при этом общее время нахождения пластиинки в печи не превышало 1 мин. Как следует из данных по испытанию БС на хрупкость, увеличение мутности в результате нескольких циклов нагрев — охлаждение коррелирует с понижением температуры хрупкости. Длительный однократный нагрев образца при  $135^\circ$  (опыт 1а) не оказывал влияния на мутность и морозостойкость. Следовательно, изменение свойств в результате многократных нагревов и охлаждений определяется не процессами рекристаллизации при  $135^\circ$ , а, вероятно, тепловыми деформациями, которые могут приводить к образованию микрополостей. Микрополости, являясь препятствием для развития магистральной трещины, улучшают морозостойкость БС.

Грозненский филиал Охтинского научно-производственного объединения «Пластполимер»

Поступила в редакцию  
15 XI 1976

#### ЛИТЕРАТУРА

1. М. А. Мартынов, В. И. Пилиповский, В. А. Григорьев, Пласт. массы, 1968, № 10, 58.
2. K. Mie, Ann. Phys., 25, 377, 1908.
3. Г. ван де Хольст, Рассеивание света малыми частицами, Изд-во иностр. лит., 1961.
4. С. Ю. Щеголев, В. И. Кленин, Высокомолек. соед., A13, 2809, 1971.
5. С. Ю. Щеголев, В. И. Кленин, Оптика и спектроскопия, 5, 794, 1971.
6. С. Н. Журков, А. А. Марихин, А. И. Слуцкер, Физика твердого тела, 7, 1159, 1959.

УДК 541(64+14):547.459

#### РОЛЬ ПЕРЕКИСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ФОТООКИСЛЕНИИ ПОЛИАМИДОВ

*Вичутинская Е. В., Макаров Г. Г., Марголин А. Л.,  
Постников Л. М.*

Решение проблемы светостабилизации полиамидов (ПА) осложняется недостаточной изученностью механизма их фотоокисления. Поскольку уже при степенях фотоокисления 3—4% ПА почти полностью разрушаются (молекулярная масса падает до  $\bar{M}_n \approx 2000$ —3000) [1], представляет интерес изучение особенностей фотоокисления ПА на начальных стадиях, в частности выяснение вопроса о первичных продуктах и их роли в фотоокислении. Предполагают [2—6], что основным первичным продуктом фотоокисления ПА является гидроперекись, которая образуется в результате последовательности реакций (через  $P_1$ , обозначен макрорадикал  $\sim CH_2CONHCH_2\sim$ )



Это предположение подтверждается результатами анализа состава конечных продуктов фотоокисления N-алкиламидов, моделирующих ПА [7, 8], хотя имеются и противоположные указания о том, что состав конечных продуктов можно объяснить реакциями рекомбинации перекисных радикалов  $P_1O_2$ , которые приводят к образованию перекисей  $P_1OOP_1$ , а не гидроперекисей  $P_1OOH$  [9, 10]. Как  $P_1OOP_1$ , так и  $P_1OOH$  определяются иодометрически [9, 10], однако данные о кинетике накопления перекис-